PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-139700

(43)Date of publication of application: 26.05.1998

(51)Int.Cl.

CO7C 31/36 CO7C 29/62 CO7C 31/42

(21)Application number: 08-316934

(71)Applicant: TOAGOSEI CO LTD

(22)Date of filing:

14.11.1996

(72)Inventor: ITO NAOKAZU

HIROSE SHUNRYO

(54) PRODUCTION OF 1.1-BIS (CHLOROMETHYL)-1 HYDROXYMETHYLPROPANE AND 1-MONO(CHLOROMETHYL)-1,1-BIS (HYDROXYMETHYL) PROPANE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject compound in one step and high yield by remarkably decreasing the amount of a lower aliphatic carboxylic acid compared with conventional process.

SOLUTION: The objective compound is produced by reacting trimethylolpropane(TMP) with hydrogen chloride gas in the presence of 0.01-0.2mol of a 2-5C lower aliphatic carboxylic acid (preferably acetic acid or propionic acid) based on 1.0mol of TMP. The reaction is preferably carried out while distilling out produced water from the reaction system. As necessary, an organic compound capable of forming an azeotropic mixture with water except for alcohols and esters (e.g. benzene, toluene or xylene) can be used as the reaction solvent. The amount of hydrogen chloride gas supplied to the system is preferably 1.0-10.0mol based on 1.0mol of TMP. The objective compound is useful as an intermediate raw material for a compound having an oxetan ring enabling ring-opening polymerization.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.01.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3228156

[Date of registration]

07.09.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (c) 1999 American Chemical Society All Rights Reserved.

Search Strategy (Patent No.)(JP 10139700)

129:54112

Preparation of 1,1-bis(chloromethyl)-1-hydroxymethylpropane and 1-mono(chloromethyl)-1,1-bis(hydroxymethyl)propane.

Ito, Naokazu; Hirose, Toshiro (Toà Gosei Chemical Industry Co., Ltd., Japan). Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 10139700 A2 26 May 1998 Heisei, 4 pp. (Japanese). (Japan). CODEN: JKXXAF. CLASS: ICM: C07C031-36. ICS: C07C029-62:

C07C031-42. APPLICATION: JP 96-316934 14 Nov 1996. DOCUMENT TYPE:

Patent CA Section: 23 (Aliphatic Compounds)

Title compds. are prepd. by reaction of trimethylolpropane (I) with HCl in the presence of 0.01-0.2 mol equiv. C_{2-5} aliph. carboxylic acids (based on I). Gaseous HCl was fed into a reactor contg. I, glacial AcOH, and m-xylene while H_2O was removed at 140-150° for 7 h to give $MeCH_2C(CH_2CI)_2CH_2OH$ and $MeCH_2C(CH_2OH)_2CH_2CI$ with 4% and 88% selectivity, resp. at 99% conversion.

Keywords

trimethylolpropane chlorination hydrogen chloride aliph carboxylic acid chlorination trimethylolpropane chloromethylhydroxymethylpropane prepn

Index Entries

Aliphatic carboxylic acids

C₂₋₅; prepn. of (chloromethyl)propanes by chlorination of trimethylolpropane with HCl in presence of aliph. carboxylic acids

Chlorination

Organic solvents

prepn. of (chloromethyl)propanes by chlorination of trimethylolpropane with HCl in presence of aliph. carboxylic acids

5381-54-4

16081-43-9

64-19-7, reactions

77-99-6

7647-01-0, reactions

prepn. of (chloromethyl)propanes by chlorination of trimethylolpropane with HCl in presence of aliph. carboxylic acids

<u>108-38-3</u>, uses

120-82-1

solvent; prepn. of (chloromethyl)propanes by chlorination of trimethylolpropane with HCl in presence of aliph. carboxylic acids

```
1/1 DWPX - (C) The Thomson Corp.
AN - 1998-357439 [31]
   - C1998-109933
   - Method for production of 1,1-bis(chloromethyl)-1-hydroxymethylpro
      pane used as intermediates for compounds having oxetane ring which
      can undergo ring-opening polymerisation
   - A41 E16
   - (TOAG) TOA GOSEI CHEM IND LTD
IN - HIROSE S; ITO N
NP
NC
     JP10139700 A 19980526 DW1998-31 C07C-031/36 Jpn 4p * AP: 1996JP-0316934 19961114
ΡN
   - JP10139700
                      B2 20011112 DW2001-74 Jpn 4p
    - JP3228156
      FD: Previous Publ JP10139700 A
      AP: 1996JP-0316934 19961114
   - 1996JP-0316934 19961114
IC - C07C-029/62; C07C-031/36; C07C-031/42; C07C-029/00; C07C-031/00
ICAA- C07C-029/62 [2006-01 A F I R - -]; C07C-031/36 [2006-01 A L I R - -]
      ; C07C-031/42 [2006-01 A L I R - -]
ICCA- C07C-029/00 [2006 C F I R - -]; C07C-031/00 [2006 C L I R - -]
   - JP10139700 A
      Method for production of 1,1-bis(chloromethyl)-1-hydroxymethylpro
      pane or 1-mono(chloromethyl)-1,1-bis(hydroxymethyl)propane by
      reacting trimethylol and hydrogen chloride gas comprises conducting
      the reaction in the presence of 0.01-0.2 mole of 2-5C lower
      aliphatic carboxylic acid per 1.0 mole of trimethylolpropane.
    - USE: 1,1-Bis(chloromethyl)-1-hydroxymethylpropane (BCP) and
      1-mono(chloromethyl)-1,1-bis(hydroxymethyl)propane (MCP) are used
      as intermediates for compounds having oxetane ring which can
      undergo ring-opening polymerisation.
    - ADVANTAGE: BCP and MCP can be easily produced in good yields by
      simple process of one step via no intermediate esters.
   - CPI: A01-E08 E10-E04C E10-E04F
   - 1998-31
UP
UE - 2001-74
```

jsh.trn Page 5

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-139700

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FΙ	
(51) Int.Ci.	10702 17-	C 0 7 C	31/36
C 0 7 C	31/36	CUIC	
			29/62
	29/62		51.40
	01/10		31/42
	31/42		

31/4	2	31, 12					
		審査請求	未請求 請求項の数2 FD (全 4 頁)				
(21)出願番号	特願平8 -316934	(71)出願人	000003034 東亞合成株式会社 東京都港区西新橋1丁目14番1号				
(22)出顧日	平成8年(1996)11月14日	東京都港区四新福11日1日 (72)発明者 伊藤 直和 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東 亚合成株式会社名古屋総合研究所内					
		(72)発明者	広瀬 俊良 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東 亞合成株式会社名古屋総合研究所内				

(54) 【発明の名称】 1, 1-ビス(クロロメチル)-1-ヒドロキシメチルプロパンおよび<math>1-モノ(クロロメチル)-1, 1-ビス(ヒドロキシメチル)プロパンの製造方法

(57)【要約】

【課題】簡素な工程で、かつ収率良く1,1ービス(クロロメチル)-1ーヒドロキシメチルブロパンまたは1ーモノ(クロロメチル)-1,1-ヒドロキシメチルプロパンを製造する方法を提供する。

【解決手段】トリメチロールプロパン1.0モル当たり、炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸を0.01~0.2モル存在させて、トリメチロールプロパンと塩化水素ガスを反応させることにより、1,1ービス(クロロメチル) -1-ヒドロキシメチルフロバンまたは1ーモノ(クロロメチル) -1,1-ヒドロキシメチルプロパンを製造する。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】トリメチロールフロハンと塩化水素ガスを 反応させて、1、1ービス (クロロメチル) ー1ーヒド ロキシメチルフロハンまたは1ーモノ (クロロメチル) ー1、1ービス (ヒドロキシメチル) フロハンを製造す る方法において、トリメチロールフロハン1.0モル当 たり、炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸を0. 01~0.2モル存在させて反応させることを特徴とす る1、1ービス (クロロメチル) ー1ーヒドロキシメチ ルプロハンまたは1ーモノ (クロロメチル) ー1、1 ー 10 ビス (ヒドロキシメチル) フロハンの製造方法

【請求項2】水と共沸組成物を形成する有機化合物のうち、アルコール類およびエステル類を除く有機化合物を反応溶媒に用い、生成する水を反応系内から留去させながら反応させることを特徴とする請求項1記載の1,1ービス(クロロメチル) 1 ヒドロキシメチルフロハンまたは1ーモノ(クロロメチル) -1,1ービス(ヒドロキシメチル)フロパンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トサメチロールブロハン(以下、「TMP」という。)と塩化水素ガスを反応させ、1,1ービス(クロロメチル)・1ーヒドロキシメチルフロハン(以下、「BCP」という。)または1ーモノ(クロロメチル)ー1,1ービス(ヒドロキシメチル)フロハン(以下、「MCP」という。)を製造する方法に関するものである。例えば、BCPおよびMCPは開環重合が可能なオキセタン環を有する化合物の中間原料として有用である。

[0002]

【従来の技術】BCPの製造方法としては、トリクロロベンゼン溶媒中、180℃~200℃の加熱条件において、TMPとTMPの等モル以上の酢酸の混合物に塩化水素ガスを供給し、生成する水を留出させながら反応させて、BCPの酢酸エステル体を得た後、過剰のメタノールを加え、加熱しながら少量の塩化水素ガスを供給し、生成する酢酸メチルおよび過剰なメタノールの共沸混合物を留出させながら、前記BCPの酢酸エステル体のエステル交換反応を行い、BCPを製造する方法が知られている(工業化学雑誌、第67巻、第485頁)。しかしながら、前記方法では、中間体であるBCPの酢酸エステル体とメタノールのエステル交換反応を行う工程が必要であり、また、利用価値の乏しい酢酸メチルとメタノールの共沸混合物が副生する等の問題があり、工業的には経済面において満足できるものではない。

[0003]

【本発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、エステル交換反応工程を要することなく、工業的に簡易な工程で、かつ経済的にBCPまたはMCPを製造する方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた結果、TMPと塩化水素ガスの反応において、酢酸等の炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸の使用量を従来の方法より著しく減少させることにより、中間体であるBCPのエステル体を経由せずに、一段階でBCPおよびMCPを収率良く製造できることを見出し、本発明を完成するに至った

10 【 0 0 0 5 】 すなわち、本発明はトリメチロールフロハンと塩化水素ガスを反応させて、1, 1ービス (クロロメチル) -1ーヒドロキシメチルフロハンまたは1ーモノ (クロロメチル) ー1, 1ービス (ヒドロキシメチル) フロハンを製造する方法において、トリメチロールプロハン1. 0モル当たり、炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸を0.01~0.2モル存在させて反応させることを特徴とする1, 1ービス (クロロメチル) ー1ーヒドロキシメチルプロパンまたは1ーモノ (クロロメチル) ー1、1ービス (ヒドロキシメチル) フロパンの製造方法である。

[0006]

30

50

【発明の実施の形態】本発明における炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸としては、酢酸、プロヒオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸およびイソ吉草酸などが挙げられるが、これらの中でも、入手し易さおよび工業的な取扱い易さの面から酢酸およびブロビオン酸が好ましい。炭素数が6個以上の脂肪族カルボン酸の場合は反応速度が遅くなる。前記炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸の使用量は、TMP1.0モル当たり0.01~0.2モルである。0.01モル未満であると、十分な反応速度が得られず、一方、0.2モルを越えても反応速度が増加せず、逆にBCPおよびMCPのエステル体の生成量が増加する。これらのエステル体は蒸留などの手段により分離回収して原料として再使用できるものの、循環量が多くなるため経済的でない。

【0007】本発明の製造方法は、TMPと前記炭素数が2~5個の低級脂肪族カルボン酸の混合液に、塩化水素ガスを連続的に供給し、生成する水を反応系内から留去させながら反応を行うことが好適である。従って、生成する水が留去する温度および圧力条件で反応を行うことが望ましく、好適な温度は50℃~250℃、更に好ましくは100~200℃である。50℃より低い温度では十分な反応速度が得られるとは言えず、一方、250℃を超える温度ではボリマー状物質などの副生物が増加する恐れがある。また、塩化水素ガスの供給速度および供給量については、未反応の塩化水素ガスが再使用が可能なため、何等制限されるものではないが、TMP1.0モルに対して、塩化水素ガス1.0~10.0モル供給することが好ましい。

【0008】前記反応において、反応に用いる原料およ

び反応生成物に対して不活性な化合物を反応溶媒として 用いることができる。反応溶媒としては、上記のように 水と共沸組成物を形成する化合物が適しており、それら のうちアルコール類とエステル類を除く有機化合物が特 に適しており、その使用によって水の留出が容易とな り、反応を円滑に行うことができる。好適な反応溶媒と しては、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、クロルベンゼン、1,2 = ジクロロエタンおよびテ トラクロロエチレンなどが挙げられる。なお、アルコー ル類およびエステル類は反応の進行を阻害する恐れがあ 10 る。反応溶媒の量としては、反応器内における原料およ び反応生成物の合計1.0重量部に対して0.1~10 0重量部が好ましく、さらに好ましくは0.25~40 重量部である。100重量部を越えると、単位容積あた りの収量の低下および反応溶媒の回収にかかるエネルギ 一の増大などの面で経済的と言えず、一方、0.1重量 部より少ない量では、反応溶媒を用いる効果が発現され るとは言えない。

【0009】本発明の製造方法は回分式、半回分式およ び連続式いずれの方式でも行うことができる。回分式で 20 反応TMP)×100 は、TMP、低級脂肪族カルボン酸および必要に応じ反 応溶媒を反応器に仕込み、次いで、塩化水素ガスを供給 し、生成する水を反応系内から留去させながら反応を行 い、所定量の水が留出したら反応を終了させる。一方、 連続式では、TMP、低級脂肪族カルボン酸、必要に応 じて反応溶媒および塩化水素ガスを反応器に連続的に供 給し、生成する水を留去させながら反応を行い、原料の 供給量に応じて、反応液を抜き出せばよい。また、反応 器としては、漕型、管型あるいは反応液と塩化水素ガス を向流あるいは並流接触させる塔型(充填物を詰めても 30 よい) などを用いることができる。

【0010】前記製造方法で得られた反応液は、必要に 応じて使用した反応溶媒、原料のTMPならびに生成物 であるBCP、MCPおよびそれらのエステル体などの 混合液であり、蒸留などの操作によって、目的物のBC PおよびMCPを分離精製できる。なお、回収されたT MP、反応溶媒および前記エステル体は反応器にリサイ クルさせて再使用できる。

【0011】本発明の製造方法は、原料であるTMPを 塩素化させて、BCPまたはMCPを得るものである が、これらが同時に製造されても良く、特にMCPはB CPの中間体でもある。前記塩化水素ガスの供給量、反 応温度および反応時間を調整することによって、任意の 比率でBCPおよびMCPを得ることができる。

[0012]

【実施例】以下、実施例および比較例により、本発明を 具体的に説明する。

【0013】実施例1~3

300mlの4ツロフラスコに、1.0モルのTMP、 0. 1モルの氷酢酸および反応溶媒としてmーキシレン 50 量サンプリングし、ガスクロマトグラフィにより、反応

を100m1仕込み、マグネチックスターラーで撹拌し ながら、常圧下で還流状態になる約140℃まで加熱 し、塩化水素ガスを0.25モル/時間の供給量で供給 し、反応を開始した。その後も撹拌しながら、還流状態 を維持すべく、徐々に温度上昇させながら、水およびm ーキシレンを留出させ、液々分離した後、キシレン層の みを反応器に戻しながら、後記表1に示す時間反応を行 った。また、最終反応温度も表1に記載する

【0014】反応終了後、反応液組成をガスクロマトグ ラフィにより分析し、TMPの転化率、BCP、MCP および各エステル体の選択率を求めた。その結果を表1 に示す。なお、TMPの転化率および各生成物の選択率 は以下の式により算出した。下記式において、%は全て モル基準である。また、下記式および表1におけるBC PEはBCPのエステル体を示し、MCPEはMCPの モノエステル体およびジエステル体の合計を示す。

TMP転化率(%)=(1-未反応TMP/仕込みTM P) $\times 100$

BCP選択率(%)=生成BCP÷(住込みTMP-未

MCP選択率(%)=生成MCP÷(仕込みTMPー末 反応TMP) × 100

BCPE選択率(%)=生成BCPE÷(仕込みTMP 一未反応TMP)×100

MCPE選択率(%)=生成MCPE÷(仕込みTMP - 未反応TMP)× 1 0 0

【0015】実施例4

水酢酸の添加量を0.15モルにした以外は、実施例2 と同様な条件で反応を行った。結果を表1に示す。

【0016】実施例5

氷酢酸の添加量を0.05モルにした以外は、実施例2 と同様な条件で反応を行った。結果を表1に示す。

【0017】実施例6

mーキシレンを使用しなかった以外は、実施例2と同様 な条件で反応を行った。結果を表1に示す。

【0018】実施例7

m-キシレンの代わりに1,2,4-トリクロロベンゼ ンを用いた以外は実施例3と同様な条件で反応を行っ た。結果を表1に示す。

【0019】比較例1 40

500mlの4ツロフラスコに、1.0モルのTMP、 1. 0モルの氷酢酸および100mlのm-キシレンを 仕込み、マグネチックスターラーで撹拌しながら、常圧 下で還流状態になる約130℃まで加熱し、塩化水素ガ スを 0. 25 モル/時間の供給量で供給し、反応を開始 した。その後も撹拌しながら、還流状態を維持すべく、 徐々に温度を上げながら、水とm-キシレンを留出さ せ、液々分離した後、キシレン層のみを反応器に戻しな がら、14時間反応を行った。反応終了後、反応液を少

6

液組成を求めた。その結果を表1に示す。

【0020】次に、2.0モルのメタノールを加え、約70℃まで加熱し、塩化水素ガスを0.05モル/時間の供給量で供給し、エステル交換反応を開始した。その後、徐々に反応温度を上げながら、メタノールと酢酸メチルを留出させ、8時間後に反応を終了した。反応終了後、ガスクロマトグラフィにより、反応液組成を求め

た。その結果を表1に示す。

【0021】比較例2

水酢酸の添加量を0.5モルとした以外は、実施例2と 同様な条件で反応を行った。その結果を表1に示す。

[0022]

【表1】

【表1】

	実施例 1	i例 1 実施例 2	実施例 3	実施例4	実施例 5	実施例 6	実施例7	比較例 1		
								エステル 交換反応前	エステル 交換反応後	比較例2
反応時間 (Hr)	7	1 4	2 1	1 4	1 8	1 4	2 1	1 4	8	1 4
最終反応温度 (°C)	150	165	170	165	165	165	170	165	160	165
TMPの転化率 (%)	9 9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BCPの選択率 (%)	4	4 2	7 7	4 4	4 3	1 5	4 3	18	5 8	3 0
MCPの選択率 (%)	8 8	4 9	1 4	4 3	5 4	7 7	4 8	10	4 2	3 2
BCPEの選択率 (%)	2	8	8	1 1	3	1	7	4 0	0	2 4
MCPEの選択率(%)	6	1	1	2	1	7	2	3 2	0	1 4

[0023]

【発明の効果】本発明の製造方法によれば、トリメチロールプロハンおよび塩化水素ガスを原料として、1,1ービス(クロロメチル)ー1ーヒドロキシメチルフロバ

ンまたは1-モノ (クロロメチル) -1, 1-ビス (ヒ ドロキシメチル) プロパンを、簡素な工程で容易に収率 よく製造することができる。



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10139700 A

(43) Date of publication of application: 26.05.98

(51) Int. CI

C07C 31/36 C07C 29/62 C07C 31/42

(21) Application number: 08316934

(22) Date of filing: 14.11.96

(71) Applicant:

TOAGOSEI CO LTD

(72) Inventor:

ITO NAOKAZU **HIROSE SHUNRYO**

(54) PRODUCTION OF 1,1-BIS (CHLOROMETHYL)-1 HYDROXYMETHYLPROPANE AND 1-MONO(CHLOROMETHYL)-1,1-BIS (HYDROXYMETHYL) PROPANE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject compound in one step and high yield by remarkably decreasing the amount of a lower aliphatic carboxylic acid compared with conventional process.

SOLUTION: The objective compound is produced by reacting trimethylolpropane(TMP) with hydrogen chloride gas in the presence of 0.01-0.2mol of a 2-5C lower

aliphatic carboxylic acid (preferably acetic acid or propionic acid) based on 1.0mol of TMP. The reaction is preferably carried out while distilling out produced water from the reaction system. As necessary, an organic compound capable of forming an azeotropic mixture with water except for alcohols and esters (e.g. benzene, toluene or xylene) can be used as the reaction solvent. The amount of hydrogen chloride gas supplied to the system is preferably 1.0-10.0mol based on 1.0mol of TMP. The objective compound is useful as an intermediate raw material for a compound having an oxetan ring enabling ring-opening polymerization.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO